高速四極電磁石とRFKOを用いたシンクロトロン用ビーム取り出しのための Panofsky型四極電磁石の研究

> 日大生産工(院)〇 増淵 聖 日大生産工 中西哲也

### 1.はじめに

重粒子がん治療では、X線など従来の放射線 治療に比べて、がん患部に線量を集中すること ができる。そのため、がん患部の周りの正常な 細胞への影響が少なく、人体への負担が少なく て済む[1]。最も効果的な照射法としてスポ ットスキャニング照射法があり、それに適した シンクロトロンからのビーム取り出し法とし てQAR法が提案されている[2]。この取り出 し法で用いる高速四極電磁石は高速制御が必 要となる。

本研究室では、高速四極電磁石として Panofsky型を研究している。この電磁石は磁場 の時間変化によりコイルに渦電流が生じる。こ の渦電流により磁場分布と応答特性に影響が でる。今回、Panofsky型四極電磁石を試作し、 静磁場分布、動磁場分布を測定したので、渦電 流を考慮した磁場分布の計算結果とともに記 述する。

# 2. Panofsky型電磁石

図1にPanofsky型四極電磁石を示す[3]。 Panofsky型は、ビーム軸に沿って板状のコイル をコアー面に設置する。このコイルを電磁石端 部でケーブル等を用いて接続し、上下面と両側 面に流れる電流の向きを逆にすることで四極



磁場を発生さ せることが出 来る。構造は、 従来型が曲線 で構成されて いるのに対し

図1 Panofsky型四極電磁石図 Panofsky型 は直線で構成され、図1から分かる通りフェラ イトのブロックの組み合わせで容易に製作す ることが出来る。また、口径内の広い範囲で均 一な四極磁場が得られる。

### 3. Panofsky型四極電磁石の磁界設計と試作

QAR 法で必要とされるPanofsky型四極電磁石 の仕様を表1に示す。ここで有効磁界領域の大 きさは、重粒子線用シンクロトロンへの適用を 考慮して決めた。磁場勾配の強さは、セパラト リクスが20%収縮されるために必要な値であ る。要求仕様を満たす磁場計算を二次元磁場解 析ソフトPoissonを用いて行った。図2は、計算 結果で磁束の分布を示す。コアの内径は横14 cm、縦4.2cmであり、長さは20cm、コイル 厚は0.1cmとした。同図には、有効磁界領域も 示している。中心軸上(y=0)の磁場分布の磁場 勾配は図3に示す。要求仕様である一様性±5% の範囲を同図に示しているが、満足できている ことが分かる。垂直方向の有効磁界領域である y=1.1cmにおいても満足できた。

次にPanofsky型四極電磁石のコイル分割数 を検討した。効率良くビーム取り出しを行なう ために、コイル電流の立ち上がりは10 $\mu$ sで 95%を目標にする。これを満たすためには、等 価的直列抵抗R=4[ $\Omega$ ]とした時インダクタンス は13.2[ $\mu$ H]以下である必要がある。Poisson による磁気エネルギーからインダクタンスを 計算した結果、12分割を採用することにした。

Panofsky型四極電磁石の試作は、市販のフェ ライトコアを用いたことにより、コアの内径は 13.4 cm、縦5.75 cm、長さ12.9 cmとなった。 また、フェライトの厚みは1 cmである。 Poissonで計算した中心軸上(y=0)の磁場分布 の磁場勾配は図4に示す。コイル幅は上下コイ

Panofsky magnet for the beam extraction from the synchrotron using a fast Q-magnet and RFKO.

Satoshi MASUBUCHI and Tetsuya NAKANISHI

ルが1.15cm、左右コイルが0.35cmである。試 作したPanofsky電磁石を図5に示す。コイルは カプトンテープでそれぞれ絶縁し、コアに両 面テープで貼り付けた。コイルの厚さは 0.02cmと0.06cmの2セットを作成し、それぞれ の測定時にコアに貼り替えて実験した。

### 表1 要求仕様

有効磁界領域	水平方向±
	6.5[cm]以上
	垂直方向±
	1.1[cm]以上
立ち上がり時間	10[μs]以内
磁場勾配g	26[G/cm]以上
磁場勾配の一様性	±5[%]以内



図2 Poissonによる計算と有効磁界領域



図3 電磁石の磁場勾配



図4 試作した電磁石の磁場勾配



図5 試作したPanofsky型四極電磁石図

# 4.磁場測定結果

### 4.1 静磁場測定

磁場測定はホール素子を用いて行った。y =0[cm]の位置において、0.5cm間隔で測定 した。コイル電流はI=14[A]で行った。プ ロットした値は3回の測定値の平均である。 y=0のx軸上の磁場勾配を図6に示す。磁場 勾配の値は相対的に表していて、実際の値は 5.5(G/cm)程度である。測定値の磁場勾配の 分布と計算で求めた磁場勾配の分布(図4) は似たものとなっている。しかし、端部付近 での磁場勾配の減少が、計算値よりもわずか に大きい。このことは、フェライトコアから のコイルのわずかな剥がれが原因であると 考えられる。



図6 静磁場分布

# 4.2 動磁場測定

図7は、コイル厚が0.06 c mで周波数は 2.5kHzと5kHzの時の磁場分布の測定結果を 示す。測定は、幅0.6cm、長さ2cm、厚さ0.5cm、 巻き数50ターンの検出コイルを用いて行っ た。ピーク電流は9.1A、y=0の位置において、 0.5cm間隔で測定した。磁場分布は、検出コ イルに誘起する電圧の実効値をプロットし ているため、左右対称な図となっており、周 波数に応じてその変化も約2倍となっている ことが分かる。



図7 動磁場分布

図8(a)はその測定値を基に計算した磁場勾 配を示していて、同図には周波数が10kHzの結 果も示している。図8(a)はy=0,ビーム軸方 向の中心(z=0)で周波数毎の磁場勾配を示 し、図8(b)は、z=0、周波数10kHzでyの位置 を変化させた時の磁場勾配を示す。なお、磁 場勾配は、他の周波数と比較しやすいように 磁場勾配の数値をx=0の値で規格化してい る。図8から磁場勾配は、側面に近づくほど磁 場勾配が強くなっていることが分かる。また、 周波数が高くなるほどその傾向が強くなるこ とが分かり、これは、渦電流による影響だと 考えられる。





図8 (a) 周波数毎の磁場勾配(b) y軸の位置毎 の磁場勾配

図9は、コイル厚が0.02cmの結果である。図 9(a)はy=0、z=0で周波数毎の磁場勾配を 示し、図9(b)は、z=0、周波数10kHzでyの位 置を変化させた時の磁場勾配を示す。コイル 厚0.06cmより変化の割合は小さくなってい て、厚みが薄くなることにより、渦電流が減 少したことが考えられる。0.02cm板の場合、 5kHzまでは表1の磁場勾配の一様性の要求仕 様を満たす値となっているが、10kHzになる と要求仕様の範囲を超えているのが分かる。



図9 (a) 周波数毎の磁場勾配(b) y軸の位置 毎の磁場勾配

### 5. シミュレーションと考察

側面に近い位置で、渦電流の影響が大きく なることについて検討する。y=0の時の静 磁場分布(図6)と比較すると、x=4cmまで の静磁場分布はほぼ平坦であり、従って、磁 場勾配が側面付近で変化が大きくなる原因 は渦電流によるものであると考えることが 出来る。そこで、上下面のそれぞれのコイル 板の渦電流分布を考える。ここで、両サイド のコイル板の渦電流による影響は、板幅が小 さく、且つ、磁束の通過方向が板の厚さ方向 ではなく幅方向なので、小さいとして無視す る。コイル板を通過する磁場が一様であれ ば、渦電流分布は式(1)で示されるように 中心をゼロとして、その両側で電流の向きは 異なる。[4]

 $j = -\delta x B [A/m<sup>2</sup>] · · · (1)$ ここで、 $\delta$ は、板の導電率、xは中心を0とし た時の距離、Bは磁束密度の時間微分である。 これに対して、Panofsky型では、磁極面中心 から端部に向かって外側ほど磁場は強くなる ので、渦電流がゼロとなる位置はコイル板中 心より端部側にずれる。このため端部側の渦 電流密度は高くなる。一方、電源から供給さ れる電流の向きは、端部側の渦電流の向きと 同じである。そのため、それぞれのコイル板 の電流密度は端部側ほど強くなる。結果とし て、磁場勾配は端部側ほど強くなると考える。

また、それぞれのコイル板にはその位置で の磁場強度に応じて渦電流は独立に流れるの で、渦電流による磁場分布は周期的に変化す る。図8には、その周期的変化が見られ、yが 大きいほどその影響が強く見られ、y=0に近 づくほどその影響は小さくなっている。これ は、渦電流による磁場が平均化されているた めと考える。コイル幅は1.15 c mであり、そ の長さで周期的に変化している。但し、検出 コイルの幅は0.6 cmと大きいため、分解能が下 がり変化は小さく測定されていると思われ る。yが0 cmに近づくほど端部で磁場勾配が強 くなる原因は分からないが、以下に述べる近 似計算でもこのような結果が得られている。

それぞれのコイルに流れる渦電流を近似し て、Poissonを用いて磁場分布を計算する。ま ず上部と下部のコイルを2:1に分割し、渦電 流の偏りを考慮した。これは、渦電流がゼロ となる位置がコイル板中心よりも0.18 c m ず れることを意味する。分割したそれぞれのコ イルに流れる渦電流は一様とし、同じ値で向 きは逆とする。即ち、広い方のコイルの渦電 流密度は狭い方の半分である。また、それぞ れのコイル板の渦電流値は、コイル板中心で の磁場強度に比例するとした。それぞれの渦 電流値を元のコイル電流値に加えて計算した 結果を図10に示す。渦電流の絶対値は、図8(b) に示す v=0の分布の変化率にほぼ等しくな るように設定した。詳細な分布は再現できて いないが、v=0に近づくほど渦電流の影響が 大きくなるなど、定性的には実験結果と同様 の傾向が見られる。

このように、渦電流の影響を考慮すると、 有効磁界領域は狭まるため、電磁石のビーム アパーチャを広くする必要がある。特に水平 方向の長さを広げる必要があるであろう。



図10 シミュレーション結果

### 6.まとめ

Panofsky型電磁石をQAR法に適用するた め、磁場設計を行い、試作機を製作した。製 作した電磁石の磁場測定をDC電流と交流で 行い、コイルに流れる渦電流の磁場分布への 影響を測定した。渦電流の影響は大きく、 0.02cm厚のコイルでも10kHzでは磁場勾配の 一様性に対する仕様を満足できないことが 分かった。渦電流の影響は、磁場勾配を端部 で大きくする方向に働き、この分布は、渦電 流を近似してPoissonで計算した磁場分布と 定性的には一致した。今後は、渦電流を考慮 した設計が必要で、ビームアパーチャを水平 方向に広げる必要があるだろう。

「参考文献」

- [1] 辻井博彦、遠藤真広、「切らずに治すが ん 重粒子線治療がよくわかる本」コモ ンズ, 2006.
- [2] 中西哲也、他 粒子線がん治療用シンク ロトロンからの新ビーム取り出し法の 研究 日本大学生産工学部第39回学術 講演会,2006,pp51-52.
- [3]L. N. Hand and W. K. H. Panofsky, THE REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS VOLUME 30. NUMBER 10 OCTOBER, 1959, pp927-930.
- [4] S. Y. Lee, Nuclear Instruments and Method in Physics Research A300(1991) 151-158 North-Holland.